

# Formation en lithographies optique et électronique

**Durée :**  
2,5 jours / 18 heures

**Dates :**  
22 / 24 mai

**Lieu :**  
Institut Jean Lamour  
Université Henri  
Poincaré, Nancy I

**Prix :**  
Adhérent ..... 1 120 €  
Non adhérent ..... 1 220 €

**Niveau :** I - II - III

**TP :** 55 %

**Documents :**  
Texte des cours

**Animateur :**  
Brice VINCENT  
Enseignant chercheur  
brice.vincent@ijl.nanc  
y-universite.fr

**Intervenants :**  
Laurent BOUVOT  
François MONTAIGNE

P10

**OBJECTIFS** Ce stage de deux jours et demi s'adresse aux techniciens et ingénieurs du milieu industriel et académique qui sont amenés à développer des procédés de lithographies optique et électronique.

Cette formation comporte des cours théoriques et des travaux pratiques mettant en œuvre des procédés de lithographie optique et électronique pour la réalisation de micro et nano-objets. Elle donne les bases théoriques et expérimentales indispensables à la mise en œuvre de ce genre de procédés dans un environnement salle blanche. Cette formation abordera aussi les aspects de dépôt par évaporation spécifique à la lithographie électronique.

## PROGRAMME

### Cours

- Lithographie optique :  
principe, configurations, procédé, applications
- Lithographie électronique : principe, procédé, applications
- Nano-impression : principe, configurations, applications
- FIB (Focused Ions Beam) : principe, applications

### Travaux pratiques

- Travaux pratiques de lithographie optique
  - Spin coating
  - Lithographie
  - Dépôt, gravure, lift-off
- Travaux pratiques de lithographie électronique
  - Dessin des masques
  - Écriture par faisceau d'électrons
  - Dépôt par évaporation
  - Lift-off
  - Caractérisation